PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01-205153

(43) Date of publication of application: 17.08.1989

(51)Int.CI.

G03C 1/68

CO8F 2/50

G03C 5/16

(21)Application number : **63-029581**

(71)Applicant: TOYOBO CO LTD

(22)Date of filing:

10.02.1988

(72)Inventor: IMAHASHI SATOSHI

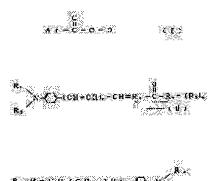
SAITO ATSUSHI

(54) PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve sensitivity for visible rays of a photopolymerizable compsn. by incorporating a specified ethylenic unsatd. compd., an org. peroxide, and a p-aminophenyl unsatd. ketone compd. into the photopolymerizable compsn.

CONSTITUTION: At least one kind of ethylenic unsatd. compd. which is gaseous at room temperature, an org. peroxide contg. a group expressed by formula I, and a p-aminophenyl unsatd. ketone compd. expressed by the formula II, are incorporated into a photopolymerizable compsn. In formula I and II, Ar is an unsubstituted phenyl or a 1W4C alkyl group, etc.; each R1 and R2 is H or 1W5C alkyl group; R3 is a methylidine group or a 1W5C alkylene-ylidine





group capable of forming a ring together with a carbonyl group by bonding with R4; R4 is C atom. or (un)substituted phenyl group, or a group which forms indanone or tetralone residue together with R3 and a carbonyl group; R5 is the formula III (wherein each R6 and R7 is H or 1W5C alkyl group). Thus, a photopolymerizable compsn. having high sensitivity for visible rays permitting the use of a low energy exposing light source is obtd.

平1-205153 ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

⑤Int. Cl. ⁴	識別記号	庁内整理番号	43公開	平成 1 年(198	9)8月17日
G 03 C 1/68 C 08 F 2/50 G 03 C 5/16	3 3 1 MDN 3 0 5	7267-2H 2102-4 J 7267-2H審査請求	未請求	請求項の数 1	(全6頁)

69発明の名称 光重合性組成物

> ②)特 願 昭63-29581

22出 願 昭63(1988) 2月10日

@発 明 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社総合

⑫発 明 瘘 滋賀県大津市堅田2丁目1番1号 東洋紡績株式会社総合

研究所内

の出 東洋紡績株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2番8号

9*F*] 細

1. 発明の名称

光重合作組成物

- 2. 特許額求の範囲
 - (a) 少なくとも一種の常温で非ガス状のエチ レン性不飽和化合物、
 - (b) 下記一般式 (I) で示される基を含有す る有機過酸化物および
 - (c) 下記一般式 (Ⅱ) で示される p アミノ フェニル不飽和ケトン化合物を含有する ことを特徴とする光重合性組成物。

(式中Arはフェニル基または炭素数1~4の アルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基、フェ ニル基、アミノ基、カルポニル基、ハロゲン原子 のうち一種以上で置換されたフェニル店を示す。) (C) 下記一般式(II) で示される p - アミノ

フェニル不飽和ケトン化合物を含有することを特

徴とする光重合性組成物。

$$\begin{array}{c} R_1 \\ N \longrightarrow (CH = CH)_n - CH = R_3 - C - R_4 = (R_5)_n \\ R_2 \end{array}$$

式中m、nはそれぞれOまたは1であり、 R,、R。は水素原子または炭素原子数1~ 5のアルキル店、Ra はメチリジン基または R』と結合してカルポニル基とともに原を形 成することができる炭素原子数 1~5のアル キレンーイリジン基、R。は炭素原子、置換 または非直換フェニル基、もしくはRaとカ ルポニル基とともにインダノンまたはテトラ ロンを形成する甚、

(但しRa、Raは水素原子または炭素原子 数1~5のアルキル基を示す)である。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は可視光の領域にまで感度を有する新規な光重合性組成物に関する。

(従来の技術)

光重合性組成物は多数の用途に広く利用されており、例えば印刷、複写、レジスト形成その他に 商業的に利用されている。

これらの組成物は一般にエチレン性不飽和化合物またはその他のタイプの重合性化合物、光開始削または光開始削系をして好ましくは溶媒可溶性または水性またはアルカリ可溶性有機重合体結合削化合物を含有している。ところが、これらの多くの既知の有用な光重合性組成物は、使用されている開始削がスペクトルの紫外部領域以外では活性化されないものが多いため、その応用範囲が限定されているのが現状である。

また光源として紫外線でなく可視光線を用いたり、アルゴンイオンレーザーなどの可視部領域に 大きな発振強度を有するレーザーで走在露光する ことが画像形成技術として要求されている。その

本発明者は以上の問題点を解決すべく、つまり、 光重合性組成物の可視光に対する態度を向上させる目的で、光開始削系について鋭意、研究、努力 した結果、遂に本発明を完成するに到った。すな わち本発明は(a)少なくとも一種の常温で非が ス状のエチレン性不飽和化合物、(b)下記一般 式(I)で示される基を含有する有機過酸化物お よび(c)下記一般式(Ⅱ)で示されるローアミ ノフェニル不飽和ケトン化合物を含有することを 特徴とする光重合性組成物。

(武中Arは非置換フェニルまたは炭素数1~ 4のアルキル店、炭素数1~4のアルコキシ基、 フェニル店、アミノ店、カルポニル店、ハロゲン 原子のいずれかで置換されたフェニル店を示す。)

$$\begin{array}{c}
 & 0 \\
 & \parallel \\
 & \parallel \\
 & -(CH = CH)_{\pi} - CH = R_{\pi} - C - R_{4} = (R_{5})_{m}
\end{array}$$

ために可視光線に対して高い感度を行する光重合性材料が要望され、可視光に対して高感度な光開始剤が必要である。

特開昭 5 4 - 1 5 5 2 9 2 号公報にはヘキサアリールビスイミダゾールを含む系、特開昭 5 8 - 1 5 5 0 3 号公報には活性ハロゲン化合物と3 - ケト 置換クマリン化合物の系、特開昭 5 6 - 4 6 0 4 号公報には3 - ケト置換クマリンと N - フェニルグリシンの系、特開昭 6 1 - 9 7 6 5 0 号公報には3 - 置換クマリンとキナゾリノン誘導体との組合せ、特開昭 6 1 - 1 2 3 6 0 3 号公報にはヘキサアリールビイミダゾールと3 - ケト置換クマリンとの組合せの光開始剤系が開示されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら前記の光開始剤系では感度が不十分であり、より低出力のレーザーで高速度で走査 露光するためには、さらに高感度な光開始剤を見 出すことが必要である。

(課題を解決するための手段)

式中m、nはそれぞれ0または1であり、R1、R2は水素原子または炭素原子数1~5のアルキル店、Raはメチリジン店またはR4と結合してカルボニル店とともに環を形成することができる炭素原子数1~5のアルキレンーイリジン店、R4は炭素原子、置換または非置換フェニル店、もしくはRaとカルボニル店とともにインダノンまたはテトラロンを形成する店、

$$R_5$$
 (at = C H-(C H = C H) $\frac{R_6}{R_7}$

(但しRa、Raは水素原子または炭素原子数1~5のアルキルはを示す)である。

本党明において使用されるエチレン性不飽和化合物は、遊離ラジカルで開始される連鎖成長付加反応に適した単量体であり、例えば、ペンタエリスリットトリアクリレート、ポリエチレングリコールジールジアクリレート、トリエチレングリコールジ

アクリレート、ポリエチレングリコールジメタク リレート、テトラエチレングリコールジメタクリ レート、トリメチロールプロパントリアクリレー ト、トリメチロールプロパントリメタクリレート などが上げられる。

れるDITミノフェニル不飽和ケトン化合物であ り、具体的には2.5-ピス(4′-ジェチルア ミノベンジリデン) シクロペンタノン、2,5-ピス(41 ージメチルアミノベンジリデン)シク ロペンタノン、2、6ービス(4′ージエチルア ミノベンジリデン) シクロヘキサノン、2、6-ピス(4′ ージメチルアミノベンジリデン)シク ロヘキサノン、2、5-ビス(4′-ジメチルア ミノシンナミリデン) シクロペンタノン、2, 6 ービス (4' ージメチルアミノシンナミリデン) シクロヘキサノン、1、3-ピス(4′-ジメチ ルアミノベンジリデン) アセトン、2-(4′-ジェチルアミノベンジリデン)-1-インダノン、 2 - (9' - ジュロリリデン) - 1 - インダノン、 2 - (4′ - ジェチルアミノベンジリデン) - 1 ーテトラロン、4′ージエチルアミノー2′ーメ チルベンジリデンーアセトフェノンなどが挙げら れる。 本発明組成物中には好ましくは熱可塑性高分子

第3の成分(c)は前記一般式(Ⅱ)で表わさ

趾有機重合体結合剤を存在させてもよい。重合体 結合剤タイプとしては (1)テレフタル酸、イソフ タル酸、セバシン酸、アジピン酸およびヘキサヒ ドロテレフタル酸に基くコポリエステル、(1i)ポ リアミド、 (ili)ピニリデンクロリド共重合体、 (iv)エチレン/ピニルアセテート共派合体、 (v) セルロースエーテル、(vi)ポリエチレン、 (vii) 合性ゴム、(viii)セルロースエステル、(ix)ポリ ビニルアセテート/アクリレートおよびポリビニ ルアセテート/メタクリレート共正合体を含むポ リビニルエステル、 (x)ポリアクリレートおよび ポリα-アルキルアクリレートエステル例えばポ リメチルメタクリレートおよびポリエチルメタク $ij \nu - 1$, (xi) 4, 000 ~ 4, 000, 000 の重量平均分子量を有する高分子量エチレンオキ シドボ合体(ポリエチレングリコール)、(xii) ポリ塩化ビニルおよびその共重合体、(xili)ポリ ピニルアセタール、 (xiv)ポリホルムアルデヒド、 (xv)ポリウレタン、 (xvi)ポリカーボネートおよ び(xvii)ポリスチレンがあげられる。

本発明の特に好ましい態様においては、米粥光 光重合性コーティングが例えばアルカリ性溶液で ある主として水性の溶液には可溶性であるが、活 性線放射に露光後は比較的それに不溶性となるよ うに、光重合性結合剤を選ぶ。典型的にはこれら の要求を満足させる重合体はカルボキシル化重合 体例えば遊離カルボン酸基含何ピニル付加重合体 である。好ましい結合剤としてはイソブタノール 混合物で部分エステル化された酸価約190、 重 量平均分子量約10、000のスチレン/マレイ ン酸無水物 (1:1) の共重合体、およびスチレ ンノマレイン酸無水物の共重合体とエチルアクリ レート/メチルメタクリレート/アクリル酸のタ ーポリマーとの組み合わせがあげられる。その他 の好ましい結合剤群としては、ポリアクリレート エステルおよびポリα-アルキルアクリレートエ ステル特にポリメチルメタクリレートがあげられ

その他の不活性添加剤例えば非重合性可塑剤、 染料、顔料および充填剤は当業者には既知である これら添加剤は一般に少量で存在せしめられ、そ してこれは光重合性層の露光を削害させるもので あるべきではない。

本発明の光重合性組成物の好ましい比率を成分(a)であるエチレン性不飽和化合物100重量部に対する重量部で表わすと、成分(b)である行機過酸化物は0.01~100重量部、特に好ましくは0.1~50重量部、特に好ましくは0.1~50重量部、結合剤は0~1000重量部、特に好ましくは0~500重量部である。

本発明光重合性組成物は広範囲な種類の基材上にコーティングすることができる。前記店材とはすべての天然または合成支持体、好ましくは可挽性または剛性のフィルムまたはシートの形で存在しうるものを意味している。例えば基材は金属シートまたは箔、合成行機樹脂のシートまたはフィルム、セルロース紙、ファイバーボードその他またはこれらの物質の2種またはそれ以上のものの

ナイロン、ガラス、セルロースアセテートフイルムその他があげられる。 特定の基材は一般に関連する適用目的により決定される。 例えば印刷回路が製造される場合には、 店材はファイパーボード上に鍋コーティングした プレートでありうる。 平版印刷プレートの製造に おいては、店材はアノード処理アルミニウムである。

複合体でありうる。特定の居材としてはアルミナ

ブラストアルミニウム、アノード処理アルミニウ

ム、アルミプラスト、ポリエチレンテレフタレー

トフイルム、ポリエチレンテレフタレートフイル

ム例えば樹脂下引きポリエチレンテレフタレート

フイルム、静電放電処理ポリエチレンテレフタレ

ートフィルム、ポリビニルアルコールコーティン

グした紙、交叉結合ポリエステルコーティング紙、

好ましくは光重合性組成物の層は0.0001 インチ (0.00025cm) ~約0.01インチ (0.025cm) の範囲の厚さを有しており、そ して光重合性層に活性な放射を通過しうる薄い可

接着性をもって接着されている。それに保護カバー 別またはカバーシートを接着させることができる。このシートはフイルム支持体と別との間の接着力よりも小さい接着力を別に対して行している。特に好ましい支持体は約0.001インチ (0.0025 cm) ~約0.4インチ (1.0 cm) の範囲の厚さを行する透明ポリエチレンテレフタレートフイルムである。また、0.0005インチ (0.0013 cm) ~0.04インチ

撓性の重合体フィルム支持体に程度ないし中等度

(0.10cm) のポリエチレンは好ましいカバーシートであり、ポリビニルアルコールコーティングは好ましいカバー層である。

通常の光顔としては405、436および546nm (Hg)被長に中心を有する狭いかまたは広い光パンドを与える蛍光燈、水銀灯、金属添加ランプおよびアークランプがあげられる。干渉光顔はパルス式キセノン、アルゴンイオン、ヘリウムーカドミウム、およびイオン化ネオンレーザーなどである。ブリントアウト系に広く使用さ

れている可視光発生陰極線管もまた本発明の組成物に関して有用である。これらは一般に電気エネルギーを光エネルギーに変換させるための手段として紫外または可視光発生性燐光体内部コーティングをそして放射を光感受性ターゲットに導くための手段として光学ファイバーフェイスプレートを包含している。

(作用)

本発明の増盛剤すなわち成分(c)は本来、本発明に使用される光開始剤すなわち成分(b)が吸収し得ないかまたは非常に小さな吸光度しか示さない可視光を効率よく吸収し、活性化される。その状態で本発明の増盛剤は本発明で使用される光開始剤に作用し、結果的に活性なラジカルを発生させ、そのラジカルが組成物中のエチレン性不飽和化合物を攻撃して、重合を超こすものと思われる。

(実施例)

以下実施例により本発明を具体的に説明するがここに部および%は重量基準ある。

実施例1~7、比較例1~4

下引き層を有する100μ厚さの透明なポリエチレンテレフタレートフイルム上に下記組成の磁光層塗工液を塗布し、熱風乾燥機にて90℃、1分間乾燥し、厚さ3μの塗膜を得た。次いでその上に7%ポリビニルアルコール(完全ケン化、重合度500)の水溶液を塗布し熱風乾燥機で100℃1分間乾燥して1μのオーバーコート層を設けて、磁度テスト片を得た。

(感光層樂工被組成)

ポリ(メタクリル酸メチル/

メタクリル酸) 52部

70/30モル比

テトラエチレングリコール

ジアクリレート 40

有機過酸化物(成分り)

5

p-アミノフェニル不飽和ケトン

(成分c) 3

メタノール

2 0 0

酢酸エチル

8 0

战 1

実施	成分(b)	成分(c)	ステップ
1	3、3′、4、4′ーテトラー (tーブチルベルオキシカルボ ニル)ベンゾフェノン	2, 5ービス (4'ージェ チルアミノベンジリデン) シクロペンタノン	13
2	"	2, 5ービス (4' ージメ チルアミノベンジリデン) シクロベンタノン	14
3	u.	2, Bービス(4'ージメ チルアミノベンジリデン) シクロヘキサノン	13
4	, n	2, 5-ビス (4' -ジメ チルアミノシンナミリデ ン) シクロペンタノン	14
5	"	2. 8-ビス (4' ージメ チルアミノシンナミリデ ン) シクロヘキサノン	12
8))	4' ージエチルアミノベン ジリデンー2ーメチルアセ トフェノン	12
7	ジ(ヒーブチルペルオキシ)イ ソフタレート	2, 5ーピス (4' ージェ チルアミノベンジリデン) シクロベンタノン	8
8	tーブチルバーオキシベンゾエ ート	n	7

クロロホルム

12088

上記感度テスト片上にネガフイルムとして
21√2ステップタブレット(大日本スクリーン
社製グレーフイルムスケール)を重ねて、キセノンランプ(ウシオ電機社製UXL-500D-0)に東芝社製干渉フィルターKL-49と同位ガラスフィルターY-45を組み合わせた光源
(490nmA)で15cmの距離から10分間露光した後、30℃0.7%炭酸ナトリウム水溶液に10秒間浸漬し、水洗して未硬化部分を除去し乾燥した後、21√2ステップタブレットの完全硬化の段数(ステップ)を調べ、それを表1に示す。また比較例を表2に示す。

以下余百

退 2

比較例	成分 (b)	成分(c)	ステップ
1	3, 3′, 4, 4′ーテトラ (tープチルベルオキシカルボ ニル)ベンソフェノン	なし	0
2	ジ(t-ブチルベルオキシ)イ ソフタレート	なし	0
3	なし	2, 5ーピス (ジェチルア ミノベンジリデン) シクロ ベンタノン	0
4	2, 2' - (0 - クロロフェニル) - 4, 4', 5, 5' - テトラフェニルピスイミダゾール	n	5
5	2, 4, 6ートリス (ドリクロロメチル) ーSートリアジン	J)	5

表1,2より明らかなように本発明の実施例1~7は比較例1~4に比べ490nmの光に対して高磁度であることが判る。

(発明の効果)

本発明の光重合性組成物は、可視光に対して高感度を示すため、低いエネルギーの解光光線を使用することができ、また、与えられた時間内に多

数の原版を露光および現像できる。また、露光額を原版より遠ざけることができるため、その光線が平行化され、例えば網点順像形成する場合、 垂直の側部を行するシャープな網点を形成することができるなど種々の利点を行している。

特許出願人 東洋紡績株式会社